



HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of the gas in the valve, wherein the duration of continuation of the pulse control and the number of times of opening the circulation of the gas in the duration of continuation are controlled to control the flow volume of the gas.

(57) 要約: 基板処理装置においてガス供給部から基板処理空間にガスを供給して基板を処理する、基板処理方法であって、前記ガス供給部は、複数のガスソースと、複数の前記ガスソースから前記基板処理空間まで前記ガスを流通させる流路と、前記流路に設けられ前記ガスの流通の開放又は閉止を切り替えるバルブと、を備え、前記バルブにおいて前記ガスの流通の開放と閉止を交互に繰り返すことで前記ガスの流通をパルス化する、パルス制御を実行し、前記パルス制御において、前記パルス制御の継続時間と、前記継続時間中における前記ガスの流通の開放の回数とを制御することで、前記ガスの流量を制御する、基板処理方法。